EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61130480

PUBLICATION DATE

18-06-86

APPLICATION DATE

30-11-84

APPLICATION NUMBER

59251568

APPLICANT: HITACHI MAXELL LTD;

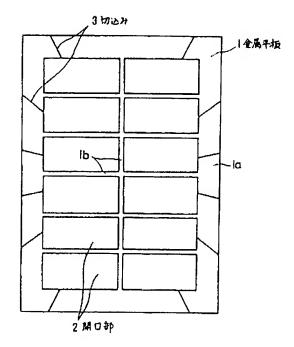
INVENTOR: SUZUKI HIROYUKI;

INT.CL.

C23C 14/04

TITLE

: MASK FOR VAPOR DEPOSITION



ABSTRACT :

PURPOSE: To decrease the out of focus of a vapor deposition pattern in a mask for vapor deposition provided with plural apertures to a metallic flat plate by providing notches from ≥1 apertures to the end of the metallic flat plate to said mask.

CONSTITUTION: Vapor deposition is executed by using the mask for vapor deposition provided with the plural apertures having a desired size to the metallic flat plate 1 consisting of a stainless steel having a prescribed size and thickness. The notches 3 extending from the apertures 2 of the mask to the end of the plate 1 and along the straight line passing approximately the center of the plate 1 are provided to the mask. The respective parts cut by the notches 3 of a peripheral part 1a move outward with respect to the central part of the plate 1 even if partition parts 1b are heated to the temp. higher than the temp. of the peripheral part 1a and the rate of thermal expansion of the former is larger than the rate of thermal expansion of the latter when the mask is heated. The difference in the rate of thermal expansion between the partition parts 1b and the peripheral part 1a is therefore absorbed by the deformation of the peripheral part 1a by the notches 3, by which the mask is surely and tightly adhered to a substrate for vapor deposition.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑲ 日本 国特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 130480

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)6月18日

C 23 C 14/04

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3 百)

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

❷発明の名称 蒸着用マスク

> ②特 願 昭59-251568

多出 願 昭59(1984)11月30日

70発明者 梅 田 砂発 明 者 中尾 健 一 郎 砂発 明 者 後 明 藤

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内 茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内 茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

四発 明 者 鈴木 浩 幸 の出 願 日立マクセル株式会社 20代理 升理士 中村 純之助

茨木市丑寅1丁目1番88号

1. 発明の名称

蒸着用マスク

2. 特許請求の範囲

- (1) 金属平板に複数の閉口部を設けた蒸着用マ スクにおいて、上記開口部の少なくとも1個から 上記金瓜平板の蟾部に至る切込みを設けたことを 特徴とする蒸着用マスク。
- (2)上記切込みを上記金属平板のほぼ中心を道 る直線に沿って設けたことを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の蒸着用マスク。

3. 発明の詳細な説明

〔蔵業上の利用分野〕

この発明は金属平板に複数個の関口部を設けた 燕着用マスクに関するものである。

(従来の技術)

第3図は従来の姦着用マスク(文献不詳)を示 す図である。図において、1は金属平板、2は金 属平板1に設けられた複数個の閉口部で、蒸着時

に蒸着用マスクを保持するため、関口部2は金属 平板1の周辺部1aを残してその内部に設けられ ている。

このような蒸着用マスクを使用して蒸着を行な うときには、通常磊着用マスクは被惑着基板に宛 着され、赤外線で加熱される。この場合、周辺部 1aにはマスク保持具が接触しているのに対し、 開口部2間を仕切る仕切部1bは細く、熱伝導に、 よる放熱量が小さいため、仕切部lbの温度が周 辺部 1 aの温度よりも高くなるから、仕切部 1 bの 熱膨張量が周辺部1aの熱膨張量よりも大きくな り、しかも仕切都lbの剛性は周辺部laの剛性よ りも小さいので、仕切部1bが被姦着基板から離 れてしまい、蒸着図形端の一部に大きなボケが生 ずる欠点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明は上述の問題点を解決するためになさ れたもので、蒸着図形のポケを小さくすることが できる蒸着用マスクを提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この目的を建成するため、この発明においては、 閉口部の少なくとも1個から金属平板の縞部に至 る切込みを設けることにより、仕切部と周辺部と の熱膨張量の差を切込みによる周辺部の変形によ って吸収する。

(実施例)

夹施例1

第1図に示すように、大きさ90m×125m。厚さ0.3mのステンレス鋼からなる金属平板1に、大きさ35m×16mの関ロ部2を12個設けた蒸券用マスクにおいて、関ロ部2から金属平板1の鳩部に至り、かつ金属平板1のほぼ中心を通る直線に沿った切込み3を設ける。

この蒸着用マスクにおいては、加熱されたときに、仕切部1bの温度が周辺部1aの温度よりも高くなり、仕切部1bの熱膨張量が周辺部1aの熱膨張量が周辺部1aの熱膨張量よりも大きくなったとしても、周辺部1aの切込み3によって切断された各部分が金属平板1の中央部に対して外方に移動するから、仕切部

に至り、かつ金属平板1のほぼ中心を通る直線に 沿った切込み3を散ける。

この悪着用マスクにおいても、蒸着図形のボケが非常に小さくなる。たとえば、切込み3がなく、他は第2図に示したものと同様の蒸者用マスクを用いて、実施例1で述べたのと同様の条件で蒸着したときには、ボケの最大値が0.6mmであったのに対して、第2図に示した蒸着用マスクを用いて、実施例1で述べたのと同様の条件で蒸着したときには、ボケの最大値は0.2mmであった。

〔発明の効果〕

以上説明したように、この発明に係る蒸者用マスクにおいては、蒸着図形のポケを小さくすることができるから、特度よく蒸着を行なうことが可能である。このように、この発明の効果は顕著である。

4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回はそれぞれこの発明に係る燕着 用マスクを示す回、第3回は従来の燕狩用マスク を示す回である。 1 bと周辺部1 aとの熱膨張量の差が切込み3による周辺部1 aの変形によって吸収される。また、金属平板1 の中央部の温度はほぼ均一であり、仕切部1 b内において熱膨張量の差が生ずることはない。したがって、蒸着用マスクを被蒸着基板に確実に密着することができるから、蒸着図形のボケが非常に小さくなる。たとえば、切込み3 がなく、他は第1 図に示したものと同様の蒸着用マスクを用いて、ガラス基板上に基板温度350℃にて厚さ2100人のIna Oaを蒸着したとき、ボケ(Ina Oaの厚さが2100人の80%から10%まで変化する長さ)の最大値が0.5mに違したのに対して、第1 図に示した蒸着用マスクを用いて上記条件で蒸着したときには、ボケの最大値が0.1mであった。

実施例2

第2図に示すように、大きさ80m×80m,厚さ 0.1mのステンレス鋼からなる金属平板1に、各 種の大きさ,形状の関口部2を16個設けた蒸着用 マスクにおいて、関口部2から金属平板1の絵部

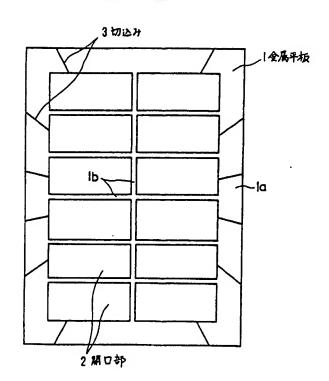
1 … 金属平板

2 … 閉口部

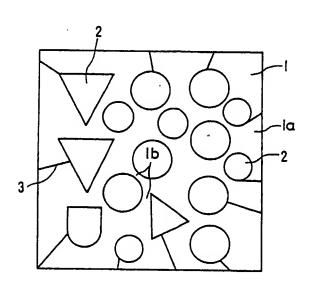
3…切込み

代理人弁理士 中 村 純之助

沙 1 図



才 2 図



沙 3 図

